

半導体製造装置開発の最前線

業界トップクラスの技術者が登壇
技術をわかりやすく解説します

講演内容

■ 露光技術概論

人類の英知と技術の結晶「露光技術」の発展と今後

キヤノン株式会社 諸星 洋

半導体素子は微細化によって性能を向上させ、人類に多大な恩恵を与えてきました。微細化を進めるのに必須な「露光技術」は人類の英知と技術の結晶です。露光技術発展の歴史を振り返り、最先端の露光技術までを紹介し、露光技術に投入された英知と技術を解説します。

■ 成膜技術概論

半導体の集積度をあげ、高性能化を実現するのは薄膜ナノ！

日本エー・エス・エム株式会社 岡川 豊

半導体は、実はオングストローム級の超薄い膜でできていると言って過言ではありません。その薄膜を生成する様々な技術を紹介します。

■ 洗浄技術概論

半導体を「洗っている」だけじゃない半導体洗浄技術

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 佐藤 雅伸

「半導体洗浄」は、半導体を洗っていると思われていますが、そもそも「半導体を洗う」とはどういうことでしょうか。講演では最先端の半導体製造を陰に日向に支えている半導体洗浄技術の本当をお伝えします。

■ 計測技術概論

半導体デバイス製造の将来を支える電子ビーム計測技術

株式会社日立ハイテク 山口 真司

今後も発展続ける半導体デバイスは構造複雑化が進み製造工程が長くなります。製造歩留まり確保維持を実現するために計測技術は益々重要になります。本講演では電子ビーム計測技術について紹介します。

お申し込みはこちら



【連携企画】新技術講演会

同日15:30から「半導体産業と技術概論」と題して、東京エレクトロン 早川 崇氏による基調講演、16:20～ものづくり賞の受賞講演（3件）が予定されています。

2024年

9月4日(水)

10:00～12:40

岡山大学 津島キャンパス
K室 (A21講義室)

参加費
無料

主催

公益社団法人 精密工学会 (JSPE)

協賛・後援

一般社団法人 日本半導体製造装置協会 (SEAJ)